

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 1 部門第 2 区分  
【発行日】平成22年2月12日 (2010.2.12)

【公表番号】特表2009-521273(P2009-521273A)  
【公表日】平成21年6月4日 (2009.6.4)  
【年通号数】公開・登録公報2009-022  
【出願番号】特願2008-547441(P2008-547441)  
【国際特許分類】

A 6 2 B 18/02 (2006.01)

【F I】

A 6 2 B 18/02 B

【手続補正書】

【提出日】平成21年12月9日 (2009.12.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

濾過フェイスマスクであって、

(a) 着用者の少なくとも鼻及び口の上にフィットするように構成され、着用された時に内部気体空間を作り出すマスク本体と、

(b) 内部気体空間に流体連通している呼気弁であって、

(i) 硬質の封止面と、吐き出された空気が内部気体空間を出るために通過しうる開口部とを含む弁座と、

(i i) 該弁座に取り付けられた可撓性フラップであって、弁がその閉鎖位置にある時に、該フラップの第一の主表面が上記封止面に接触するように弁座に取り付けられており、又、呼気中に、上記フラップが上記封止面から離れて撓み、吐き出された空気が上記開口部を通過して、最終的に外部気体空間へ流出できるように弁座に取り付けられている可撓性フラップにして、単層構造の形態を有し、上記閉鎖位置にある時に偏倚されておらず、0.0050以下の片持ち曲げ比を呈する可撓性フラップとを含む呼気弁と、を含む濾過フェイスマスク。